

29TF-am08

含リン脱離基法を基盤とするシアリルルイス X ガングリオシドの合成研究

○鈴木 規敏¹, 中村 精一¹, 橋本 俊一¹(¹北大院薬)

【目的】当研究室ではこれまで含リン脱離基を基盤とするグリコシル化反応及び糖鎖合成戦略の開発を行ってきた。その過程で得られた知見を活用してシアリルルイス X (sLe^x) ガングリオシドの合成を行う。

【方法・結果】当研究室で開発した 2-アセトアミド-2-デオキシ糖供与体を用いるグリコシル化反応を経て二糖 **1** を調製した後、MPM 基を除去してジオール **2** を得た。ジオール **2** に対して糖供与体 **3** を作用させたところ、反応は 4 位水酸基で優先的に進行し、四糖 **4** が得られた。現在、フコシル化の検討を行っており、グルコシルセラミド **6** とのカップリングを経て sLe^x ガングリオシドに導く計画である。

